# 芳香族ポリイミドの合成と機能化の新展開 ーポリイミドーシリカハイブリッド材料を中心としてー

東京工業大学工学部有機材料工学科

柿本 雅明

## 1. はじめに

芳香族ポリイミドが、その耐熱性と機械特性をかわれて大いに発展したのは周知の通りである。表1にポリイミドの特性と機能の概略を示す。機能面を見てみると、液晶配向膜やフォトレジスト材料はすでに商品化され、最近では真空蒸着ポリイミド薄膜やフッ素化ポリイミドが次の機能性ポリイミドとして出発しようとしている。ポリイミドは機械特性や電気特性ばかりでなく、化学的にも興味ある反応性を示し、種々の方法で機能化が可能である。ポリイミドは不溶、不融であるため、可溶性前駆体高分子であるポリアミド酸の段階でフィルム等に成形され、300℃の熱処理によりポリイミドとされる。このプロセスは煩雑であるが、逆にこれによりポリイミドの高性能化が可能となったと言える。本稿ではポリイミドの機能化の一例としてゾルーゲル法を応用したポリイミドーシリカハイブリッド材料の作製について述べる。

# 表 1 ポリイミドの特性と機能

- 1. Performance
  High Tg, Tm, and Td
  High Strength and Modulus
  Low Crystallinity
- 2. Functionality
  Low Dielectric Constant
  Photoresists
  Ultra Thin Films
  Composites

# 2.ポリイミドーシリカハイブリッド材料の作製

ゾルーゲル法は金属アルコキシドから出発し、加水分解と縮合反応を経て無機物である金属酸化物を合成する方法で(式1)、純粋な金属酸化物が比較的低温で得られることから注目されている。金属がシリカの場合には、ガラスの機能化という観点から、有機物とガラスのハイブリッドの作製に応用されてきた。たとえばホールバーニング効果を示す有機材料の固定化が報告されている。

高分子同士は容易に相溶しないが有機の低分子化合物である金属アルコキシド と高分子は相溶する可能性が高い。そこで、高分子と金属アルコキシドを溶液 中で混合し、ゾルーゲル反応を進行させながら成形するという方法で、高分子 -金属アルコキシドハイブリッド材料が作製されてきている。しかし、ゾルーゲル反応の進行にはある程度の熱が必要で、耐熱性の高いポリイミドに拡張すれば、より酸化物構造が成長したハイブリッド材料の作製に有利である。

ポリイミドの合成法を式(2)に示すが、ポリイミド4は溶媒に不溶なので、ポリアミド酸3のアミド系溶媒の溶液ストし、このものを300℃で加熱処理もしてポリイミド4のフィルムとする。そのものを300℃で増製しておず、ポリアミド酸3の良溶媒で海でまず、ポリアミド酸3の良溶媒で溶液の溶が、ポリアミド酸3の良溶媒で溶液でます。サウェトキシシラン(TEOS)がテトラエトキシシラン(TEOS)がテトラエトキシシラン(TEOS)がプロッドを作製してから、加熱処理によりポリイミドーシリカハイブリッド材料

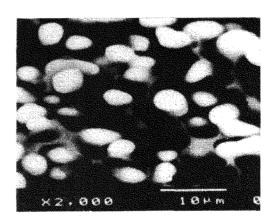


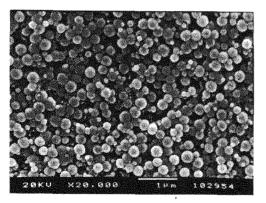
図1.DMAC法により作製したポリイミドーシリカハイブリッド材料(シリカ含量70w%)の破断面のSEM写真

とした(スキーム1の上段)。1)得られたハイブリッドフィルムの走査型電子 顕微鏡(SEM)写真(図1)によれば、生成したシリカの粒径は2~8 μ m で、マトリックスであるポリイミドとは大きく相分離しており、シリカ含量が 8%を越えると不透明になった。熱重量測定においてポリイミドの分解温度以 前にも重量減少が観察されたが、これは、ハイブリッドフィルム中のシリカ相 で完結していなっかたゾルーゲル反応が進行し、生成した水が蒸発したためと 考えられる。機械特性は比較的良好で、70%のシリカを含有したフィルムで も自己支持性を有していた。

ポリアミド酸ーシリカハイブリッドフィルムを作製するときに使用した溶媒 であるDMAcはポリアミド酸には良溶媒であるが、TEOSやそれから生成 するシリカ成分にとっては貧溶媒となる。そこで、スキーム1の下段に示すよ うに、溶媒をシリカ成分にとって良溶媒であるメタノールにかえて同様の実験 を行った。<sup>2)</sup>ここで、ポリアミド酸自信はメタノールには溶解しないので、ポ リアミド酸のかわりにそのトリエチルアミンの塩5を使用した。

得られたハイブリッド は、50%のシリカ含量 のものであっても見た目 に透明であった。ところ が、空気中800℃でポ リイミド成分を分解し、

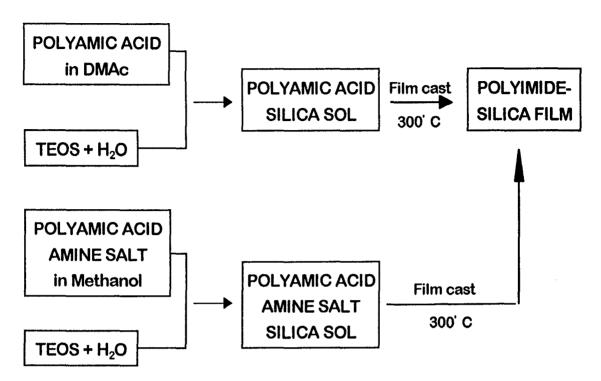
残ったシリカ成分のSEM写真によると、0.2μmの粒径の均一な粒子が連 続しているモルホロジーが観察された(図2)。同じモルホロジーがハイブリ ッドフィルムをヒドラジン処理してポリイミド成分を除去したときにも観察さ



面のSEM写真

れることから、300℃での熱処理によ り発生したモルホロジーではないこと がわかる。一方、光学顕微鏡によりスピ ノーダル分解による相分離構造が観察 され、粒子の連続構造がSEM写真に見 られることとも考え合わせると、ハイブ リッドのモルホロジーは「反応誘起相分 離」<sup>3)</sup>により生成したものと考えられる。 すなわち、ポリアミド酸トリエチルアミ 図2.メタノール法により作製した ン塩5とTEOSは溶液状態で相溶し ポリイミドーシリカハイブリッド ているがゾルーゲル反応の進行に伴い 材料(シリカ含量40 w%)の破断 シリカ成分の分子量が大きくなり相分 離を起こす。このとき、スピノーダル型

### Scheme 1



の相分離を起こし、その後、シリカ成分は球形化してゆく。相分離がスピノーダル型であるため、最終的に得られた球状のシリカは連続相となる。また、相分離した後のシリカ相で球形化するため、粒径がそろうこととなる。一方DMAc法の場合には、SEM写真では大きく相分離しており、反応誘起相分離の機構ではないように思われるが、この場合にも光学顕微鏡によりスピノーダル分解による相分離構造が観察されたことから、メタノール法と同じ機構による相分離であると思われる。

さて、溶媒の違いによりこれだけ大きなモルホロジーの差がでる理由であるが、均一溶液からシリカ成分の分子量の増大により相分離が起こる点は、溶媒がDMA c でもメタノールでも同じスピノーダル分解であると思われる。DMA c が溶媒の場合には、DMA c がシリカ相にとって貧溶媒であるため、相分離がシリカ成分の分子量があまり大きくないところで起こる。この状態では、TEOSもしくは低分子量のシリカ成分が多く存在しており、相分離したシリカを核に成長し、結果的に数 $\mu$  m径のシリカに成長したものと思われる。一方、メタノールはシリカ成分の良溶媒であるため、シリカ成分は高分子量化し、スピノーダル分解が十分に進行した後に球形化すると考えられ、DMA c の場合と比べて球形が小さくしかも連続したモルホロジーが出現したものと考えられる。

このようにして得られたポリイミドーシリカハイブリッドの動的機械特性を

図3に示す。貯蔵弾性率はシリカ成分が増加すると大きくなり、固いものを混入した効果がよく分かる。また、tanδのピークがポリイミドのガラス転移温度で観察された。この大きさは、DMAc法の場合、シリカ成分が増加してもあまり大きくは変化しないが、メタノール法の場合には大きく減少する。これは、固いシリカ成分が粒子の連続した緻密なネットワークを形成して、ポリ

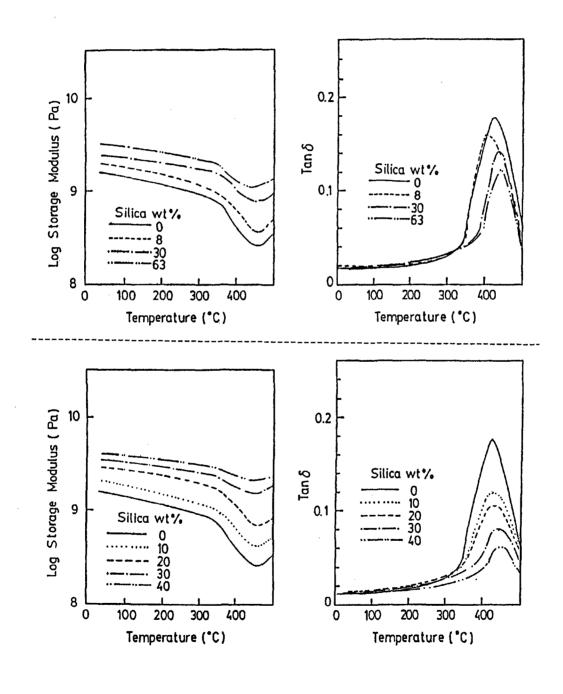


図3. ポリイミドーシリカハイブリッドフィルムの動的機械特性 上半がDMAc法、下半がメタノール法

イミド分子の運動が制限されているためと考えられる。メタノール法で作製したハイブリッドフィルムはDMAc法で作製したものよりも脆く、シリカ含量50%のフィルムしか作製できなかった。この事実もシリカ相のネットワーク形成を支持しているとともに、DMAc法で作製されたハイブリッドでは、ポリイミド相が連続相になっていることを示している。

つぎに、シリカの粒径を制御する目的でポリイミドにエトキシシリル基をペ ンダント型で導入することを試みた、4)エトキシシリル基を有するジアミン6. 7,8を合成し、ピロメリト酸無水物に対して4,4'ージフェニルエーテルと共 重合する形でポリアミド酸を得た。このジアミン成分はシリカ相とポリイミド 相とを連結し、相溶剤として働くはずである。共重合ポリアミド酸を使用して DMAc溶媒中、前述の操作によりポリイミドーシリカハイブリッドフィルム を作製した。ポリアミド酸中のエトキシシリル基の量と得られたハイブリッド フィルムの外観を比べてみると、エトキシシリル基の量が多いほど透明なフィ ルムが得られる。これらのSEM写真では、シリカは独立した粒で存在してい るものの、エトキシシリル基の量が多くなると粒径は減少し、マトリックスの ポリイミドに包まれた状態で存在することが明らかとなった。図4に示すSE M写真で、BEI は後方散乱 (Back Scattered) 法、SEI は 2 次イオン電子 (Secondary Electron's Image)法により測定されたもので、SEI の像の方がより表面を観察 している。このようにして作製されたハイブリッドフィルムの動的粘弾性を図 5に示すが、エトキシシリル基の量が増加するにつれ t a n δ の値は減少し、 ポリイミドの運動が制限されていくのがわかる。

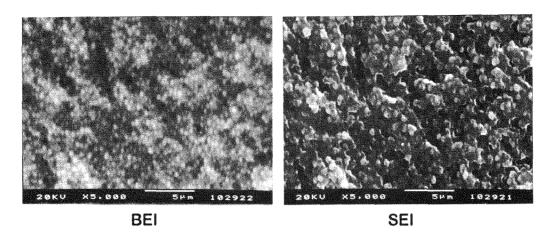
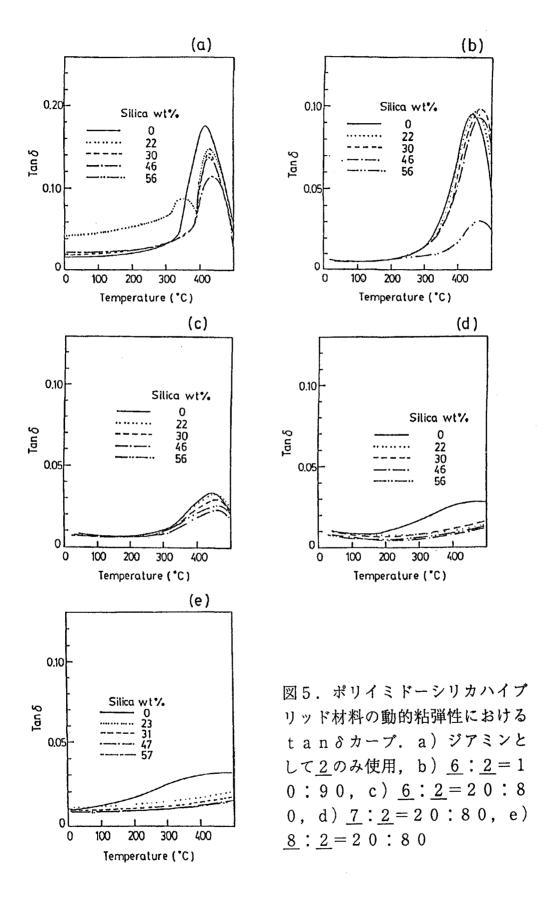


図4. ジアミン7(20%)とジアミン2(80%)から合成されたポリイミドとシリカとのハイブリッドフィルム(シリカ含量69w%)の破断面のSEM写真

TEOSを使用すると理想的には無機物であるシリカが生成する。しかし、メチルトリメトキシシランをTEOSの代わりに使えば、メチル基が導入されたゲルが生成するはずで、これはシリコーンゴムとして知られているものである。ポリイミドとのハイブリッドはTEOSを使用したときと同じ方法で作製でき、5-7)DMAc溶媒で作製した場合、シリカとのハイブリッドと同じようなモルホロジーが観察された。大きく異なるのは機械特性で、シリカとのハイブリッドの場合には弾性率は増大し、硬い成分の導入が特徴づけられたが、シリコーンとのハイブリッドにおいては、弾性率は減少しむしろタフな材料としての性質が観察された。

### 3. おわりに

以上、ポリイミドーシリカハイブリッド材料の作製について述べた。総じて言えることは、ハイブリッドの形成が単にシリカの粒をポリアミド酸の溶液中で混合した場合とは大きく異なるという点である。つまり、ゾルーゲル法で作製した場合にはより多量のシリカを均一な粒径で導入することができる。これによりハイブリッドの機械特性は向上する。この点は大変興味深く、ゾルーゲル法におけるシリカ粒の生成が相分離過程を経由しており、無機高分子ではあるが、有機高分子同士の相分離の理論が応用できそうである。最近、我々は高圧下でポリイミドを重合させる方法を開発したが、これを応用してハイブリッド材料を作製している。



さて、つぎにケイ素以外の金属の酸化物とポリイミドとのハイブリッドを作製したいところであるが、これがなかなか困難であることがわかった。たとえば、チタンの場合を考えてみると、まずアルコキシチタンのゲル化速度がアルコキシシランのそれと比べ非常に早く、制御が難しいことがあげられる。また、ケイ素の場合とは異なりチタンはカルボキシル基と反応して塩を形成するため、ポリアミド酸とアルコキシチタンを混合するだけでゲル化するという問題もある。いくつかの安定化剤を添加して検討しているが今のところ成功していない。より機能性の大きい無機酸化物と高分子とのハイブリッドの作製を考えると、基礎技術として多くの金属酸化物とのハイブリッドが可能であるようにしておきたいと考えている。

### 文献

- 1) A. Morikawa, Y. Iyoku, M. Kakimoto, and Y. Imai, Polym. J., 24, 107 (1992).
- 2) A. Morikawa, H. Yamaguchi, M. Kakimoto, and Y. Imai, *Chem. Mater.*, 6, 913 (1994).
- 3) Y. Nakayama, T. Inoue, *Polymer*, 30, 662 (1989).
- 4) A. Morikawa, Y. Iyoku, M. Kakimoto, and Y. Imai, J. Mater. Chem., 2, 679 (1992).
- 5) Y. Iyoku, M. Kakimoto, and Y. Imai, High Performance Polym., 6, 43 (1994).
- 6) Y. Iyoku, M. Kakimoto, and Y. Imai, High Performance Polym., 6, 53 (1994).
- 7) Y. Iyoku, M. Kakimoto, and Y. Imai, High Performance Polym., 6, 95 (1994).